

RadTech Asia 2011



JUNE 20-23, 2011
Yokohama, Japan

Sponsored by RadTech Japan

www.radtechasia2011.org

会議概要

会期：2011年6月20日～23日

会場：パシフィコ横浜

(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

会議 URL：<http://www.radtechasia2011.org>

お問合せ先：RadTech Asia 2011 運営事務局

株式会社 ICS コンベンションデザイン内

〒101-8449 東京都千代田区猿樂町1-5-18 千代田ビル

TEL: 03-3219-3541 FAX: 03-3219-3577

ご挨拶

2011年6月20日-23日にパシフィコ横浜でRadTech Asia 2011国際会議が開催されます。最新のわが国や世界のUV・EB加工に関する市場の動向や、技術的課題を討議の中心課題としながら、今後の新しい科学技術や産業のシーズを創出するための情報交換や研究開発の支援の場とすることにし、特に、環境関連技術として再利用可能材料・生分解性材料の創製や、省エネルギー型の高品位の露光・照射装置の開発、さらに、ナノテク産業の基盤となる、計測装置・計測技術の開発や、高性能ナノ材料の開発などをトピックスとして取り上げます。

また、一層の充実を図りました展示会も併設で開催いたしますので、皆様のご参加をお待ちしています。

RadTech Asia 2011 組織委員会
組織委員長 西久保 忠臣

セッション概要

S-1 ナノインプリント

ナノインプリントは新しいリソグラフィ技術で、ナノ構造体パターンを高スループットで形成します。機械的型押し方式によるナノインプリント技術は従来の光回折方式やビーム散乱方式では不可能な解像度を実現します。ナノインプリント技術は装置、プロセス、関連材料などの発展につながります。ナノインプリントは研究開発と工業製品製造の両方で機能性材料および機器を生み出す重要技術として認識されています。今回のナノインプリント・セッションではナノインプリント技術の現状やLEDなどの各種機器への応用を取り上げます。

S-2 ナノ・リソグラフィ

パターンング物質とプロセスの進化は半導体業界の今後を担います。装置の小型化の中心となるのは光露光リソグラフィです。そして光露光リソグラフィでは高性能レジストの開発が中心でした。このセッションではナノ・リソグラフィの材料と化学処理に関する論文の提出を歓迎します。このセッションのテーマはEUVおよびArF向けのフォトリソグラフィの設計、分子レジスト、レジスト材料の基礎研究、機構研究などです。従来とは異なるナノイメージングへのレジストの新規応用に関する論文も対象になります。

S-3 グリーン・テクノロジー

グリーン・テクノロジーは社会の持続的発展を支える重要技術です。グリーン・ケミストリー12原則に従い、化学製品は機能が同じなら毒性がなるべく低いものを製造し、また補助物質(溶剤、分離剤など)はなるべく減らし、使うにしても無害なものを使用することが要求されます。環境配慮型UV/EB処理技術は有害物質の発生を最小限に抑制します。消費エネルギーは環境および経済への影響を考慮した上で最小化する必要がありますが、グリーン・テクノロジーはエネルギー消費と製造の効率を極大化する効果もあると期待されます。このセッションでは環境に配慮したプロセス、化学製品、装置を取り上げます。

S-4 ディスプレイ技術の新傾向

ディスプレイは人間と装置の間の重要なインターフェースです。近年、3Dディスプレイやエレクトロルミネセント素子など、ディスプレイおよびその周辺の技術が急速に進歩しています。このセッションではディスプレイ技術の世界リーダーたちが動向を説明します。

S-5 フィルム成形技術

フィルム成形はコーティング物質のムダを排し環境保護にも貢献することから高性能3D向け基体としてウェット・コーティングに代わる技術です。UV/EB技術はキズや引っ張りに強く、耐候性、伸び特性などがあることから硬化フィルム用に適しているだけでなく環境にもやさしい技術です。このセッションでは硬化フィルム、プロセス制御、ハードウェアの市場拡大に向けた技術状況を検討します。

招待講演

▶ Area Overviews

"An Overview of the UV/EB Curing Markets in the North American and the Outlook for the Future of the Technology (UV/EB)"

David Harbourne (*Fusion UV Systems, Inc., USA*)

"Korean Market Overview"

In Hyo Kim (*Shinyoung Rad.Chem.Ltd, Korea*)

"Applications and Progress of UV/EB Curing Technology in China"

Wenfang Shi (*University of Science and Technology of China (USTC), China*)

"Overview of UV Technology in Asia (tentative)"

Iyer R. Siva (*Cytec Industries Inc., China*)

"Japan Overview of Radiation Curing Market and Technology"

Takashi Ukachi (*JFC Co.,Ltd., Japan*)

"Overview of Radiation Curing Market in Europe"

Wim Vanderghinste (*Cytec Industries Inc., Belgium*)

▶ Special Sessions

S-1. Nano Imprint

"UV Nanoimprint Process and Its Application to Micro/nano Devices"

Hiroshi Goto (*Toshiba Machine Co., Ltd., Japan*)

"Current Status of Nanoimprint and Its Application"

Shinji Matsui (*University of Hyogo, Japan*)

"UV Nanoimprint Process for Higher LED Brightness"

Norimichi Okuda (*SCIVAX Corporation, Japan*)

S-2. Nano Lithography

"Development of EUV Resist for 22-nm Half-pitch and beyond Presenter"

Toru Kimura (*JSR Corporation, Japan*)

"Radiation Chemistry of Resists for Extreme Ultraviolet Lithography (tentative)"

Seiichi Tagawa (*Osaka University, Japan*)

"EUV Lithography Resist and Materials Challenges Beyond the 22nm Half Pitch"

Stefan Wurm (*SEMATECH, USA*)

S-3. Green Technology

"Synthesis of Star-Shaped Oligomeric Lactic Acids with Reactive Double Bonds and Their Application to UV Curable Coatings"

Koji Morita (*Nippon Bee Chemical Co., Ltd., Japan*)

"Current Status and Future Prospects for Organic Solar Cells"

Yoshinori Nishikitani (*JX Nippon Oil & Energy Corporation, Japan*)

S-4. New Trend in Display Technology

"Flexible Organic Light-Emitting Diode Displays for Automobiles"

Kunio Akedo (*TOYOTA Central R&D Labs., Inc., Japan*)

"Spatially-ordered Polymers Self-assembled in Ordered Liquid Crystal Templates"

Liang-Chy Chien (*Kent State University, USA*)

S-5. Technology of Film Molding System

"Development of New Generation Hardcoated Films for Complex 3D Shapes Film Insert Molding (FIM) Application"

Gordon Wong (*Bayer Material Science Ltd, Hong Kong*)

"Development of New Film-In-Mold System Using Flexible PET Film with High-Temperature Elongation/Formability"

Junichi Shirakawa (*DuPont Kabushiki Kaisha, Japan*)

*他にも多数の魅力的な招待講演及び一般演題を予定しています。
詳細は会議ホームページ (www.radtechasia2011.org) をご参照ください。